

光谱学与光谱分析

ITO表面研磨处理对有机电致发光器件性能的影响

王 丽, 张希清, 林 鹏, 熊德平, 黄世华

北京交通大学光电子技术研究所, 信息存储、显示与材料开放实验室, 北京 100044

收稿日期 2003-12-25 修回日期 2004-5-8 网络版发布日期 2005-8-26

**摘要** 用一种特制的纳米研磨粉磨擦方法处理ITO表面, 用扫描探针显微镜研究了ITO表面形貌, 发现ITO表面尖峰明显减少, 表面粗糙度降低; 研究了ITO处理与没做处理的双层结构有机电致发光器件, 发现ITO处理的器件在亮度和效率方面都有明显提高。分析了器件性能提高的原因, 认为是由于ITO处理的器件提高了注入载流子并且降低了界面势垒。

**关键词** [OLED](#) [ITO](#) [表面处理](#) [纳米研磨粉](#)

**分类号** [O484](#)

**DOI:**

通讯作者:

王 丽

#### 扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDE\(461KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(OKB\)](#)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

相关信息

▶ [本刊中 包含“OLED”的 相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

· [王 丽](#)

· [张希清](#)

· [林 鹏](#)

· [熊德平](#)

· [黄世华](#)